第13回 日本表面科学会中部支部 学術講演会プログラム

2013年12月21日(土) 9:45~16:55 名古屋工業大学 2号館C棟2階 I1(アイ1)教室

		講演者	所属	学年	講演題目
9:45 - 9:50	支部長挨拶 (豊田工業大学 大学院工学研究科 吉村雅満)				
9:50 - 10:05	1	高木 将樹	豊田工大院	M1	銅化合物で修飾した酸化タングステンの光触媒活性
10:05 - 10:20	2	太田 紘志	静岡大院・エ	М1	色素増感太陽電池のための酸化チタン表面における増感色素吸 着の研究 PDTC 分子によるN719 色素の吸着量増加
10:20 - 10:35	3	Rangga Winatyo	静岡大 創造科学技術大学院	<u>D3</u>	Increase in the open circuit voltage of aligned ZnO nanorods- based dye sensitized solar cells
10:35 - 10:50	4	矢野 航	名古屋工大院·機能工学	M1	ドライプロセスによる有機ー無機接合アクチュエータの作製と変 位電圧特性の評価
10:50 - 11:00	休憩(10分)				
11:00 - 11:15	5	岩辺 あい	静岡大学・エ	В4	表面ナノ構造によるTMP 分子の挙動制限に関する研究
11:15 - 11:30	6	伊藤 嵩人	名古屋工大•工	В4	表面張力を駆動力としたマイクロ流路の構造最適化
11:30 - 11:45	7	Laura Tiong	山梨大学	M1	Energy Conversion of Microalgae (Chlorella vulgaris) with Catalytic Supercritical Water Gasification
11:45 - 12:00	8	川村 亮平	名古屋工大院	M1	両親媒性分子のプラズマ照射により作製した重合薄膜のナノ構 造解析
12:00 - 13:00	昼食(60分)				
13:00 - 13:45	宮	'崎 誠一 先生	名古屋大学	【チ	ュートリアル講演】半導体-メタル 接触界面の構造について
13:45 - 14:00	9	DENG Yunsheng	名古屋大院•工	<u>D3</u>	Epitaxial formation and electrical property of Ni Germanide/Ge(110) contact
14:00 - 14:15	10	荒井 崇	名古屋大院・エ	M1	SiOx/TiO2積層した Ti 電極 MIMダイオードの抵抗 スイッチング
14:15 - 14:25	休憩(10分)				
14:25 - 14:40	11	新田 高洋	岐阜大学·工	助教	摩擦界面その場観察によって明らかとなった巨視的滑り運動と接 触領域で起こる剥離の関係
14:40 - 14:55	12	張 海	名古屋大院・エ	<u>D2</u>	リモート水素プラズマ支援によるSiO2 上へのFe ナノドットの高密 度・一括形成
14:55 - 15:10	13	竹内 和歌奈	名古屋大院・エ	助教	低温固相成長Ge へのSn 導入による正孔移動度の向上
15:10 - 15:25	14	鈴木 悠平	静岡大院・エ	М1	Ga イオン注入による P ドープ 薄膜 SOI層のゼーベック係数の変化
15:25 - 15:40	15	池 進一	名古屋大院・エ	M2	高輝度放射光X 線マイクロ回折法によるGe1-xSnx/Ge 微細構造 内部の局所歪評価
15:40 - 15:50	休憩(10分)				
15:50 - 16:05	16	寺島 辰也	名古屋大院・エ	M2	Ge1-x-ySixSny エピタキシャル層の結晶構造の成長温度および 熱処理依存性
16:05 - 16:20	17	木戸脇 翔平	名古屋大院・エ	M2	Si(110)上 Ge1-xSnxエピタキシャル薄膜の成長機構および転位 構造
16:20 - 16:35	18	大原 穂波	名古屋大院・エ	M2	SiC(000-1)C面上における均一な大面積グラフェンの作製と評価
16:35 - 16:50	19	藤田 隼	名古屋大院・エ	M2	高配向・高密度カーボンナノチューブ膜へのカルボラン内包とそ の評価
16:50 - 16:55	副支部長挨拶 (静岡大学 大学院工学研究科 村上 健司)				
17:30	懇親会(会費:一般4,000円,学生1,000円,講演者無料 @名古屋工業大学 大学会館)				

[※]講演はすべて液晶プロジェクターを使用します。時間は15分です。(発表10分, 質疑応答5分)

第1鈴:8分, 第2鈴:10分, 第3鈴:15分

[※]懇親会にて講演奨励賞授与を行います。講演者はできるだけ参加してください。